

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2006年11月16日 (16.11.2006)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2006/121081 A1

- (51) 国際特許分類:
C07C 253/34 (2006.01) C07C 255/03 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2006/309407
- (22) 国際出願日: 2006年5月10日 (10.05.2006)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2005-136820 2005年5月10日 (10.05.2005) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 旭化成ケミカルズ株式会社 (ASAHI KASEI CHEMICALS CORPORATION) [JP/JP]; 〒1008440 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 佐野 和彦 (SANO, Kazuhiko). 大山 菊男 (OHYAMA, Kikuo). 日名子 英範 (HINAGO, Hidenori).
- (74) 代理人: 小栗 昌平, 外 (OGURI, Shohei et al.); 〒1050003 東京都港区西新橋一丁目7番13号 栄光特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
- 2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: HIGH-PURITY ACETONITRILE AND PROCESS FOR PRODUCING THE SAME

(54) 発明の名称: 高純度アセトニトリル及びその製造方法

(57) Abstract: A process for producing high-purity acetonitrile having a low absorbance at a wavelength of 200 nm. It requires a reduced amount of energy for purification and the purification step is simple. It considerably diminishes the propionitrile contained in acetonitrile. The process for high-purity acetonitrile production is characterized by mixing hydrous crude acetonitrile with an alkali, separating the mixture into an acetonitrile phase and an aqueous phase, removing the aqueous phase, subjecting the resultant acetonitrile phase to a distillation step to obtain purified acetonitrile, and passing the resultant purified acetonitrile through an cation-exchange resin to obtain high-purity acetonitrile.

(57) 要約: 本発明は、精製に用いられるエネルギーが少なく、精製工程も簡易なプロセスであり、アセトニトリル中に含まれるプロピオニトリルを著しく減少させ、波長200nmでの吸光度の低い高純度アセトニトリルを製造する方法の提供することを目的とする。本発明は、含水粗アセトニトリルをアルカリと混合し、アセトニトリル相と水相に分離して水相を除去し、得られたアセトニトリル相を蒸留工程に通して精製アセトニトリルを得、得られた精製アセトニトリルを陽イオン交換樹脂に通して高純度アセトニトリルを得ることを特徴とする高純度アセトニトリルの製造方法に関する。

WO 2006/121081 A1